

DERWENT-ACC-NO: 1996-337354  
DERWENT-WEEK: 200022  
COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Dull processing method for a cooling roll surface - includes dull processing roll surface for cold rolling using pulse laser with emitted laser pulse comprising an initial spark part and a pulse tail part

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON STEEL CORP[YAWA]

PRIORITY-DATA: 1994JP-0324013 (December 2, 1994)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 08155506 A	June 18, 1996	N/A	008	B21B 027/00
JP 3027695 B2	April 4, 2000	N/A	008	B21B 027/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 08155506A	N/A	1994JP-0324013	December 2, 1994
JP 3027695B2	N/A	1994JP-0324013	December 2, 1994
JP 3027695B2	Previous Publ.	JP 8155506	N/A

INT-CL (IPC): B21B027/00; B23K026/00 ; B23K026/06 ; H01S003/121

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 08155506A

BASIC-ABSTRACT: The method comprises dull-processing a roll surface for cold rolling using a pulse laser, where a Q-switch CO laser having a Q-switch appts. made up of a telescope lens and a rotational chopper in its resonator is used as a laser oscillator and the laser pulse emitted from the oscillator is a pulse consisting of an initial spark part and a pulse tail part.

USE - For maintaining roll roughness, improving abrasion resistance and lengthening service life of the roll.

ADVANTAGE - Processing can be carried out at high speed with one laser oscillator.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/12

TITLE-TERMS:

DULL PROCESS METHOD COOLING ROLL SURFACE DULL PROCESS  
ROLL SURFACE COLD ROLL  
PULSE LASER EMIT LASER PULSE COMPRISE INITIAL SPARK PART PULSE  
TAIL PART

DERWENT-CLASS: M14 M21 P51 P55 V08 X24

CPI-CODES: M14-A04; M21-A02A;

EPI-CODES: V08-A03D; V08-A09; X24-D03;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1996-106643

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1996-284167

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

特許第3027695号  
(P3027695)

(45)発行日 平成12年4月4日(2000.4.4)

(24)登録日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

B 2 1 B 27/00

B 2 1 B 27/00

B

B 2 3 K 26/00

B 2 3 K 26/00

E

J

26/06

26/06

E

H 0 1 S 3/121

H 0 1 S 3/121

請求項の数2(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平6-324013

(22)出願日

平成6年12月2日(1994.12.2)

(65)公開番号

特開平8-155506

(43)公開日

平成8年6月18日(1996.6.18)

審査請求日

平成10年4月22日(1998.4.22)

(73)特許権者

00006655

新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72)発明者

小林 尊道

神奈川県相模原市淵野辺5-10-1 新  
日本製鐵株式会社 エレクトロニクス研  
究所内

(72)発明者

浜田 直也

神奈川県相模原市淵野辺5-10-1 新  
日本製鐵株式会社 エレクトロニクス研  
究所内

(74)代理人

100089510

弁理士 田北 嵩晴

審査官

金 公彦

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 冷延ロール表面のダル加工方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 パルスレーザを用いて冷間圧延用のロール表面をオフラインダル加工する方法において、レーザ発振器が、共振器内部にテレスコープレンズと回転チョッパーからなるQスイッチ装置を有するQスイッチCO<sub>2</sub>レーザであり、該発振器より放出されるレーザパルスが、初期スパイク部分とパルステール部分から構成されるパルスである冷延ロール表面のダル加工方法であって、前記レーザパルスが初期スパイク幅100n~1μsec、パルステール幅0.9~29μsec、パルス全幅1~30μsec、ピークパワー5~300kW、パルス繰り返し周波数0.4~40kHzを有し、その集光ピーク出力密度が40MW/cm<sup>2</sup>以上、1.0GW/cm<sup>2</sup>以下であることを特徴とする冷延ロール表面のダル加工方法。

2

【請求項2】 前記レーザパルスにより加工されたロール表面の加工穴が外径D:120~350μm、深さd:8~40μm、ピッチP:1.5D~5Dの間隔で規則的な模様となることを特徴とした、請求項1記載の冷延ロール表面のダル加工方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は冷延ロール表面のダル加工方法に関するもので、圧延中のロール粗度を維持せしめ、耐摩耗性向上、ロール寿命延長を図るために、特に、冷間タンデム圧延機の間スタンドのロール表面に施すダル加工方法に関する。

【0002】

【従来技術】 従来、ロールのダル加工方法としては、ショットブラスト、放電加工等が用いられていたが、ロー

ル表面のダル形態や凹凸寸法の再現性が悪く、均一な加工を施すことは困難であった。この問題を解決する方法として、パルスレーザによるダル加工が存在し、その方法特許、装置特許共に多数出願されている（特開昭54-61043号公報、特開昭54-158798号公報等）。

【0003】ダルロールを作製する理由は、塗装鮮映性に優れた銅板の作製を目的とする事が多いが、その他に、特開平4-313405号公報のごとく、ロールの長寿命化を目的とする事がある。冷間圧延ロール長寿命化の実現には、ロールの摩耗量を減少させ、同時に銅板とロールのかみつきが生じない範囲で摩擦係数を高める必要があり、その実現には、広ピッチ、深穴加工のダル加工を施すことが望ましい。その理由は、ピッチが狭いとロールの等価的圧下量が増加し、摩耗量が増大するため、及び、表面平均粗度Raの大きなロールほど摩擦係数が高くなるためである。広ピッチの条件下で大きな平均粗度を維持するには、深穴加工が必須となる。また、銅板の圧延中にロールの摩耗は進展するが、長期間にわたってロール表面粗度を維持する為にはダル部分の穴凹部の残存率を長期にわたって維持する必要があり、その観点からも、加工穴は深い程有利である。

【0004】次にダルロールの加工処理時間について述べる。筆者らの知見では、従来ロールでの圧延可能距離は約100kmであり、圧延時間は約3時間である。オフラインでダル加工をタンデムミル中間スタンドに施すことを考えると3時間以内に3スタンドのロールにダル加工を施し、ロール組替え時間を確保しなければならない。ロール組替えには数分の時間を要するので、1時間以内に1本のレーザ処理を終了する必要がある。余裕を持った作業の遂行には、処理時間は短い程好ましい。

【0005】すなわち、本目的の実現には、高ピッチ深穴加工を短時間で実行する技術が必須となる。上記の加工を効率よく実現するために、高パルスエネルギーかつ高繰り返しレーザを用いた加工が必要となる。一例として、665mm直径、2200mm胴長の圧延ロールに340μmピッチのダル加工処理を1時間以内に完了するためには、約4×10<sup>7</sup>個の穴を開ける必要があり、そのために、11kHzの発振周波数を有するレーザが必要となる。従来ダル加工に使用されていたレーザでは上記の短時間、深穴加工を実現することは困難であった。

【0006】従来、ダル加工に利用されてきたパルスレーザは連続波CO<sub>2</sub>レーザの外部チョッピングによるパルスレーザ（特開昭55-94790号公報、特開平1-215404号公報）、QスイッチYAGレーザ（特開昭54-158798号公報）等であった。パルスレーザとしては従来のQスイッチCO<sub>2</sub>レーザ、ノーマルパルスYAGレーザ等のパルスレーザも存在するが、これらはダル加工には不適當であった。従来のQスイッチCO<sub>2</sub>レーザとしては共振器内に過飽和吸収体、電気光

学素子等の透過型光学素子を挿入する方法および、回転ミラーを共振器内部に組み込む方法等が提案されている。ところが、共振器内に透過型光学素子を挿入する手法では、高平均出力レーザ光の透過に伴う発熱により光学素子が熱的に破損する等の問題が生じ、数100Wの平均出力を取り出すことはできず、その結果、高パルスエネルギーと高パルス繰り返しを同時に実現することはできない。また、回転ミラーを共振器に組み込む方式でも、ミラーの高速回転制約により、10kHz以上の高繰り返しパルスを発生することは困難である。加えて、上記のQスイッチCO<sub>2</sub>レーザのパルス時間波形は、図11に示したQスイッチYAGレーザ波形と時間幅は異なるが、その波形は類似しているため、後述する初期スパイクのみで構成される時間波形となり、穴加工には不適當である。また、ノーマルパルスYAGレーザにおいても、フラッシュランプの放電繰り返し制約およびフラッシュランプ寿命（一般的に10<sup>7</sup>ショット程度）に起因するメンテナンス頻度の問題から、実現は困難であった。

【0007】ダル加工に適用されているレーザとして、まず始めに、外部チョッピングによるパルスCO<sub>2</sub>レーザの問題点を述べる。

【0008】図8と図9には特開平1-215404号公報に記載された外部チョッピングによるパルスCO<sub>2</sub>レーザの装置図とダル加工が示されており、その代表的な時間波形例を図10に示す。このパルスレーザは連続波レーザを時間的にチョッピングする為時間波形は矩形波となり、そのピーク強度は、図10に示すごとく基本的には連続波レーザの場合と同等であり数kWレベルである。このレーザを用いた穴加工の特徴は、スリット開放時間を延ばすことにより、大パルスエネルギーを取り出し、楕円加工を施すところにある。しかし、パルス時間幅を制御してパルスエネルギーを変化させても、単位面積当たりに導入されるパルスエネルギー密度が等しいために、基本的にはほぼ一定の穴深さの加工しか実現できない。よって、深穴加工と穴径の同時制御が必要とされるロールの長寿命化という目的には上記従来レーザは使用できない。

【0009】また、外部チョッピングのそのほかの問題点を述べる。レーザ光をチョッパーで遮っているときの光エネルギーはチョッパーにより反射されているため、加工に使用されるパルスエネルギーはレーザ出力の一部であり、発振器に導入する電気エネルギーに対する加工効率という点では、かなり効率の悪いものになる。加えて、光を遮っているときは常にレーザ光がチョッパーに照射されるため、チョッパーにダメージが発生し易く頻度の高いメンテナンスを要求するという欠点がある。

【0010】次の従来例として音響光学素子を用いた高繰り返しQスイッチYAGレーザの場合について述べる。QスイッチYAGレーザの典型的な時間波形は、図

11に示すごとくパルス半値幅が数100nsecの短パルスである。音響光学素子を用いたQスイッチ発振の原理は、音響光学結晶に電気変調を加えて結晶中に音波の疎密波を発生させ、音波の粗密波による光の回折効果を用いて時間的に共振器損失を与えることにより、パルス発振を行うものである。大パルスエネルギーを得るべく、強励起を行うと、光の回折による共振器損失よりも共振器利得の方が高くなり本来パルス発振が抑制されるべき時にもレーザ発振が持続することになる。つまり、パルス発振に連続発振成分が重畳してしまう。なお、この現象は繰り返し周波数を高くするほど顕著になる。この連続発振成分はロール回転方向に連続的に照射されるため、外部チョッパーによるパルスCO<sub>2</sub>レーザの場合と同様に、エネルギーのロール回転方向への分散が生じ、穴加工には寄与せず単なるエネルギー損失となってしまう。よって、この場合深穴加工は困難となる。よって、単一パルスとしての出力エネルギーの上限は数10mJ程度が限界となる。図12は一般的な市販QスイッチYAGレーザパルス出力の繰り返し周波数依存性である。図より、繰り返し周波数10kHzでのパルスエネルギーは10mJ弱となり、この程度のパルスエネルギーでは、5μm程度の深さの穴加工しか実現できず、ロール長寿命化の目的には適用できない。高繰り返しにおけるQスイッチYAGレーザの低パルスエネルギーを克服するために、複数レーザの重ね合わせを実施する例もあるが、高々10μm程度の穴加工を実現しているに過ぎない。さらに、装置の大型化、メンテナンス頻度の増加等の実作業に関する問題点があり、高繰り返しQスイッチYAGレーザはロール寿命延長のための装置としては好ましくない。

#### 【0011】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、パルスレーザを用いて冷間圧延用のロール表面をダル加工する方法において、外部チョッパーによるパルスCO<sub>2</sub>レーザ、あるいは波形制御擬似QスイッチパルスYAGレーザを用いた場合に生じるロール回転方向へのエネルギー拡散がなく、また、パルスエネルギーの小さなQスイッチYAGレーザを用いた場合の加工限界を克服する冷延ロール表面に深穴ダル加工を高速に、且つ再現性良く実現するレーザダル加工方法を提供することにある。

#### 【0012】

【課題を解決するための手段】本願の請求項1記載の発明は、パルスレーザを用いて冷間圧延用のロール表面をオフラインダル加工する方法において、レーザ発振器が、共振器内部にテレスコープレンズと回転チョッパーからなるQスイッチ装置を有するQスイッチCO<sub>2</sub>レーザであり、該発振器より放出されるレーザパルスが、初期スパイク部分とパルステール部分から構成されるパルスである冷延ロール表面のダル加工方法であって、前記レーザパルスが初期スパイク幅100nsec〜1μsec、

パルステール幅0.9〜29μsec、パルス全幅1〜30μsec、ピークパワー5〜300kW、パルス繰り返し周波数0.4〜40kHzを有し、その集光ピーク出力密度が40MW/cm<sup>2</sup>以上、1.0GW/cm<sup>2</sup>以下であることを特徴とする冷延ロール表面のダル加工方法であり、請求項2記載の発明は、前記レーザパルスにより加工されたロール表面の加工穴が外径D：120〜350μm、深さd：8〜40μm、ピッチP：1.5D〜5Dの間隔で規則的な模様となることを特徴とした、請求項1記載の冷延ロール表面のダル加工方法である。

#### 【0013】

【作用】以下に本発明を詳細に説明する。図1に本発明によるパルス時間波形を示す。本発明によるパルスは初期スパイク部分1とパルステール部分2から構成されており、その詳細な説明は後述する。図2は本発明ダル照射方法の概要図であり、後述するレーザ発振器3、ベンドミラー4、ノズル5、集光レンズ6、一軸ステージ7、被加工ロール8、ロール回転装置9から構成され、後述するレーザビーム10が従来法と同様の手法で被加工ロール8に集光照射される。

【0014】この時のダル加工形状について説明する。ロール寿命延長のためには深穴、広ピッチが有効であることは従来欄で述べたが、図3(a)(b)に圧延距離の穴深さ(穴径150μm時)、穴径(穴深さ10μm時)依存性を示す。穴深さは5μmよりも深いときに通常ロールよりも圧延距離が延びて、20μm以上では圧延距離は飽和することがわかる。よって、この範囲内であれば圧延距離は有効に延びるが、圧延とともにロール表面が約5μm摩耗することを考慮して、穴深さdは8〜40μmの範囲が必要である。

【0015】また、穴径は100μm以上で通常ロールよりも圧延距離が延び、250μm以上で飽和し、これ以上大きな穴を開けても圧延距離は改善しない。しかし、ダル加工断面図は図4に示されるように円錐台であり、ロール表面の5μmの摩耗と共に約2割穴径も減少する事を考慮し、穴径Dは120〜350μmの範囲が必要である。なお、これ以上の大径、深穴加工は過大なレーザ入熱を要求するため、単一レーザで短時間で処理を完了するという目的を考えると現実的ではない。

【0016】次に、加工ピッチが密になるとダル山部分が重なり合う状況が生じ、突起部分の表面積はかなり小さくなるため等価的な圧下率が高くなり、摩耗量が増加する。逆に、ピッチが5Dよりも広くなると、大径、深穴加工を施しても平均粗度Raは通常ロール以下となることから、ピッチPは1.5D〜5Dの範囲が必要である。

【0017】次に本発明によるQスイッチCO<sub>2</sub>レーザの時間波形について図1を用いて詳細に説明する。図1中のAの領域が短パルス・高ピークを有する初期スパイ

ク1部分、Bの領域が長パルス・低ピークを有するパルスステール2部分であり、この2成分から構成されることが本発明の特徴である。CO<sub>2</sub>レーザの利得媒質には二酸化炭素、窒素、ヘリウムの混合ガスを用いるが、上記パルスはこの前2者のガスを効率よく使って実現されるものである。本発明によるレーザパルスは図5に示すごとく、共振器内部にテレスコープ11、12を有し、その共焦点位置に回転チョッパー13を配備するQスイッチデバイスにより発生されるQスイッチパルスである。なお、レーザ共振器はリアミラー14と、CO<sub>2</sub>レーザの波長の光をほぼ完全に透過するコーティングを施したウィンドウ15、テレスコープレンズ11、12、及び回転チョッパー13、出力ミラー16から構成され、リアミラー14とウィンドウ15間（図5の斜線部分）に利得媒質である、二酸化炭素、窒素さらにヘリウムガスが充填されている。

【0018】Qスイッチパルスの初期スパイク1は主に放電励起によりCO<sub>2</sub>分子が直接レーザ上準位に励起されることで形成されたレーザ利得による発振であり、パルスステール2はCO<sub>2</sub>分子での回転準位緩和及び励起N<sub>2</sub>分子からCO<sub>2</sub>分子へのエネルギー移剰による発振である。Qスイッチレーザの初期スパイク1のピーク値は、主にQスイッチを行う瞬間のレーザ利得とQスイッチ速度（チョッパー13の回転速度）で決定されるという特徴がある。また、パルスステール2長さはQスイッチ開放時間で決定される。直接励起された二酸化炭素の上準位寿命は500μsec弱と短い、窒素の上準位寿命はmsec程度とかなり長く、窒素分子から二酸化炭素分子への分子間衝突によるエネルギー移剰によって、等価的な二酸化炭素上準位寿命がmsecレベルまで長くなる。その結果、初期スパイク1終了後も連続波出力程度のパワーを持続することが可能であり、回転チョッパー13のスリットによって、パルスが切り落とされるまでパルスステール2発振が継続する。つまり、回転チョッパー13の回転速度および、放電励起強度により初期スパイク1の制御が可能であり、Qスイッチを閉じることでレーザ発振を停止させ、パルスステール2長を任意の時間に制御することが可能である。すなわち、回転チョッパー13のスリット幅とチョッパー回転速度でパルス時間波形の制御が可能である。スリット幅を狭くし、チョッパー13の回転速度を速めることにより、パルスステール2が殆ど存在しない短パルスが得られ、スリット幅を広げ、チョッパー回転速度を遅くすることで、パルスステール2主体の長パルスを得ることが出来る。また、パルス発振周波数は回転チョッパー13のスリット数とチョッパー回転速度で制御可能であり、筆者らは90kHzまでの高繰り返しQスイッチ発振を確認している。以上の説明より、上記パルスレーザが高速ロール処理に有効であるため、ダル加工による冷延ロールの長寿命化に適用可能である事がわかる。この様なパルス波形の制御は、

共振器内部にテレスコープ11、12と回転チョッパー13を配備したQスイッチCO<sub>2</sub>レーザで実現されるものであり、連続波CO<sub>2</sub>レーザの外部チョッパーによるパルスレーザや、従来のQスイッチYAGレーザでは実現できない。

【0019】次に穴加工のプロセスについて説明する。定性的には、ロール8表面に初期スパイク1が照射されると、初期スパイク1のピーク強度により金属表面が熔融、蒸発を開始する。次にパルスステール2部分が被加工物に到達すると、数μ〜数10μsecの時間範囲でゆっくり熱を加えることにより初期熔融相が蒸発し、更に深部の金属が熔融蒸発を開始する。深部の熔融金属は図2に示されるノズル5より噴出されるアシストガスの圧力によって穴周辺部に吹き飛ばされるため、さらなる深穴加工が実現される。

【0020】図6はロール8上でのパルスエネルギー50mJ、集光径140μmの時の、初期スパイク1のピーク出力密度に対する加工穴深さ特性である。この図によれば、1.0GW/cm<sup>2</sup>以上のピーク出力密度を導入すると、初期スパイク1により生じる逆制動輻射吸収によって、パルスステール2エネルギーがロール8表面に到達せず、8μm以上の深穴加工が実現できないことがわかる。また、40MW/cm<sup>2</sup>以下のピーク出力密度以下では、50mJを確保するためのパルス時間幅が40μsec程度となり、後述するようにパルスエネルギーのロール8への伝熱によって、8μm以上の深穴加工は実現されない。よって、パルス照射に当たって、ピーク出力密度は40MW/cm<sup>2</sup>以上、1.0GW/cm<sup>2</sup>以下である必要がある。

【0021】この場合の、初期スパイク1ピーク出力は154kWであるが、ピーク出力の上限値は集光径に依存する。ダル加工径350μmを考え、集光径を350μmにした場合は、920kW弱までのピーク出力上限値が許されるが、この値は発振器能力限界から考えて現実的ではない。また、高ピーク出力実現の為に強励起を行うと、レーザパルスの初期スパイク1後に小さなパルスが複数重畳するマルチパルス現象が生じ、本目的のパルス波形から逸脱してしまう。このマルチパルスが生じるピーク出力は300kW強であり、以上の説明から現実的なピーク出力上限値は300kWとなる。次にピーク出力下限値について説明する。筆者らの知見によると、パルス全幅が30μsec以上の長パルス照射を行うと、加工が進行する以前にパルスエネルギーが伝熱によりロール8内部に拡散する結果、深穴加工が実現できないことがわかっている。30μsec、5mJのパルスで照射したときの穴深さは8μm以下であった。このとき、5mJパルスのピーク出力は5kWであり、加工深さ要求より、本発明を実現するためのピーク出力下限値は5kWが適当である。以上の結果より、初期スパイク1のピーク出力は5〜300kWが必要である。ちな

みに、350  $\mu$ m穴径の加工は、30  $\mu$ sec、150 mJパルスで達成された。

【0022】次にパルス時間幅について説明する。前述したごとく、パルスエネルギー50 mJパルス全幅が30  $\mu$ sec以上の長パルス照射を行うと、加工が進行する以前にパルスエネルギーが伝熱によりロール8内部に拡散する結果、加工性能が劣化する。また、パルス全幅が1  $\mu$ sec以下の短パルスでは、パルスエネルギーを占める初期スパイク1成分が増加することにより、プラズマ影響により加工性能が著しく劣化する。よって、パルス全幅は1～30  $\mu$ secが適当である。

【0023】また、初期スパイク1とパルステール2の比は前述したごとく、回転チョッパー13のスリット幅とチョッパー回転速度および、励起強度で制御可能であるが、本発明で使用する5～150 mJのパルスエネルギーを実現すると、初期スパイク9は100 n～1  $\mu$ secの範囲となり、その結果、パルステール10は0.9～2.9  $\mu$ secの時間幅となる。

【0024】更に、パルス繰り返し周波数は、ダル加工要求ピッチより決定される。胴長2200 mm、直径665 mmのロールに最小径120  $\mu$ mのダル穴を最小ピッチ180  $\mu$ mで1時間以内に処理するためには39.4 kHzの発振周波数が要求され、最大径350  $\mu$ mのダル穴を最大ピッチ1.75 mmで1時間以内に処理するためには0.42 kHzの発振周波数が要求される。よって、本発明の実現のためには0.4～40 kHzの発振周波数が必要である。この発振周波数は回転チョッパー13のスリット数とチョッパー回転速度で充分制御が可能である。

#### 【0025】

【実施例】本発明によるダル加工実施例を説明する。図4は本発明によるダル加工穴の断面図である。本実施例のダル加工を施したレーザ特性はパルス時間幅9.8  $\mu$ sec、ピークパワー125 kW、パルス繰り返し周波数6 kHz、パルスエネルギー50 mJであり、そのパルス波形は図1に示されている。焦点距離2.5インチのZnSe製集光レンズ4で集光照射を行った。なお、アシストガスとして窒素を使用した。また、被加工物はクロムを5%含有するタンデムミル用の胴長2200 mm、直径665 mmの冷間圧延ロール6であり、本実施例においては約250  $\mu$ m径、約30  $\mu$ m深さ、500  $\mu$ mピッチのダル加工を処理時間51分で実現した。本実施例ロールの圧延前平均粗度Raは1.7  $\mu$ mであり、図7に示すごとく本実施例においては圧延可能距離が250 kmとなり、グラインダー研削で作製したRa

=1.2  $\mu$ mの通常ロールと比較して約2.5倍の寿命延長効果を確認した。

#### 【0026】

【発明の効果】以上説明したように、パルスレーザを用いて冷間圧延用のロール表面をダル加工する方法において、本発明により、一台のレーザ発振機で、深穴加工を高速に、且つ再現性良く実現することが可能となり、冷間圧延可能距離が上昇し、ロール寿命延長効果が得られた。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる、レーザパルス波形の模式図であり、実施例で使用したレーザパルス波形である。

【図2】本発明に係わる、レーザ照射方法の模式図である。

【図3】本発明の作用を説明するための図である。

【図4】本実施例によるダル加工穴の断面図である。

【図5】本発明に係わる、レーザ発振方法の模式図である。

【図6】本発明の作用を説明するための図である。

【図7】本実施例の圧延結果を示す図である。

【図8】従来例によるレーザ照射方法の模式図である。

【図9】従来例によるダル加工形状の模式図である。

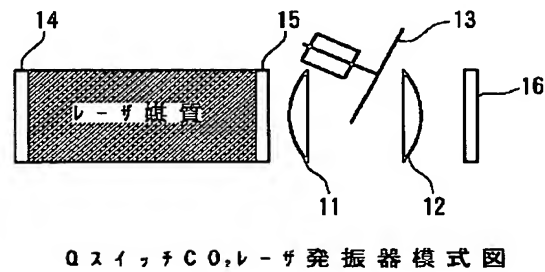
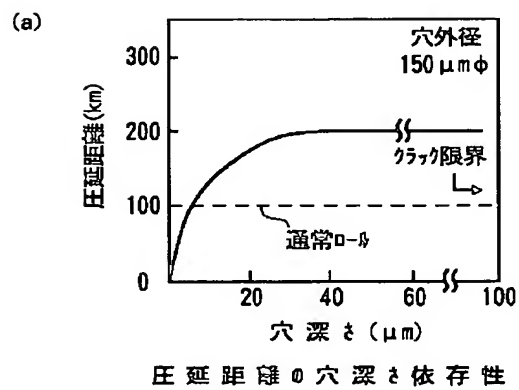
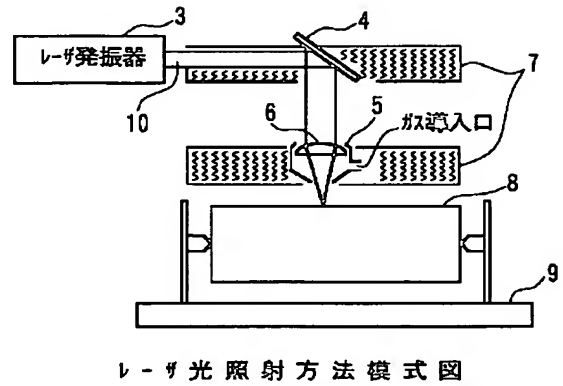
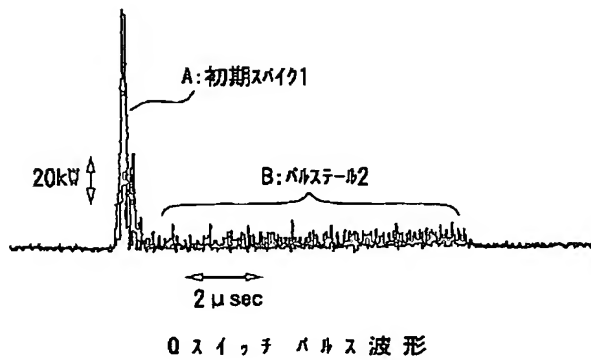
【図10】従来例のパルスCO<sub>2</sub>レーザのパルス時間波形の模式図である。

【図11】従来例のQスイッチYAGレーザのパルス時間波形である。

【図12】従来例のQスイッチYAGレーザのパルスエネルギーの発振周波数依存性である。

#### 【符号の説明】

- 1 初期スパイク
- 2 パルステール
- 3 レーザ発振器
- 4 ベンドミラー
- 5 ノズル
- 6 集光レンズ
- 7 一軸ステージ
- 8 ロール
- 9 ロール回転装置
- 10 レーザビーム
- 11, 12 テレスコープレンズ
- 13 回転チョッパー
- 14 リアミラー
- 15 ウィンドー
- 16 出力ミラー
- 17 従来技術の連続波CO<sub>2</sub>レーザ発振機



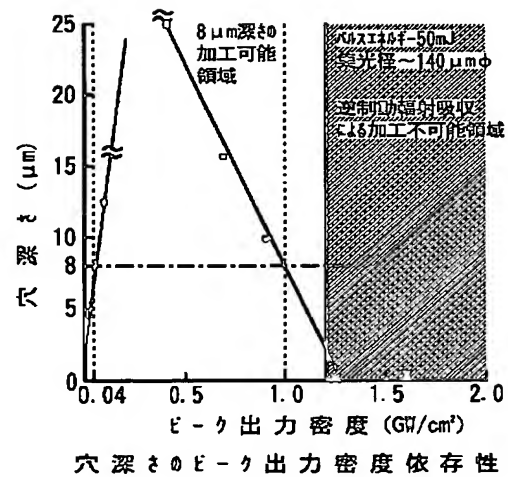
(b)

穴深  $10\ \mu\text{m}$

圧延距離 (km)

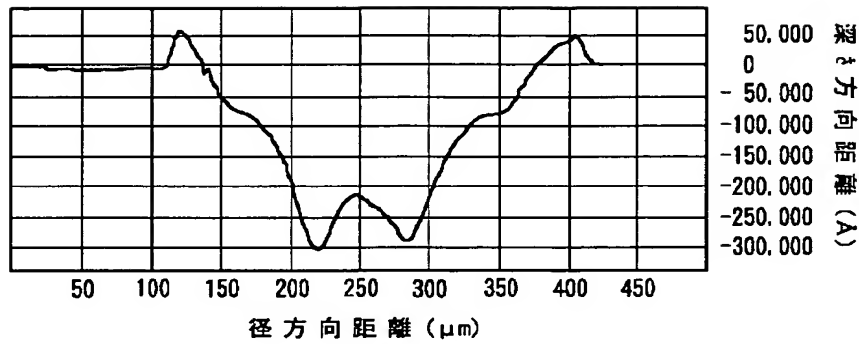
穴 径 ( $\mu\text{m}$ )

圧延距離  $\phi$  穴径 依存性



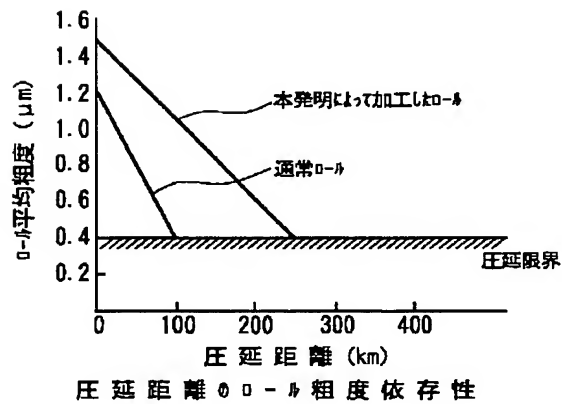


【図4】



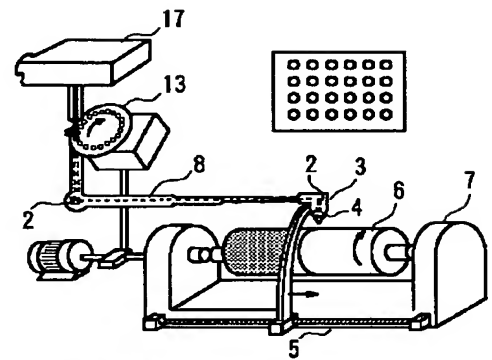
タタ加工穴断面図

【図7】

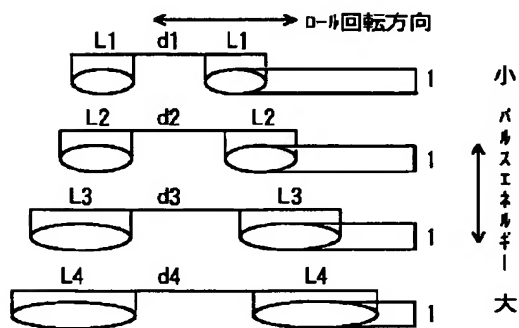


圧延距離のロール粗度依存性

【図8】

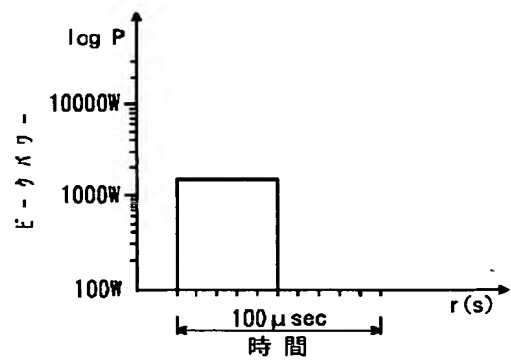
従来の連続波CO<sub>2</sub>レーザーの外部チョッパによる照射方法

【図9】

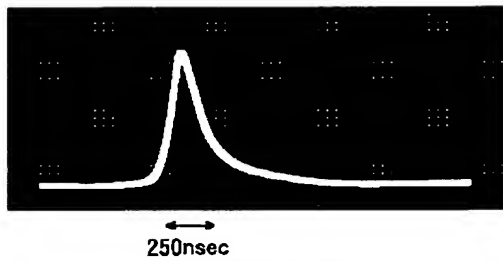


従来技術によるタタ加工例

【図10】

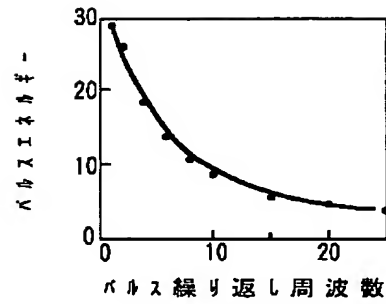
従来の連続波CO<sub>2</sub>レーザーの外部チョッパによるパルス波形

【図11】



QスイッチYAGレーザの典型的パルス波形

【図12】



高繰り返しQスイッチパルスレーザ、パルスエネルギーのパルス繰り返し周波数依存性

フロントページの続き

(72)発明者 若狭 和式  
千葉県君津市君津1番地 新日本製鐵株  
式会社 君津製鉄所内

(56)参考文献 特開 昭63-20191 (J P, A)  
特開 平6-57335 (J P, A)  
特開 昭56-160892 (J P, A)  
特開 平6-63784 (J P, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.<sup>7</sup>, DB名)

B21B 27/00  
B23K 26/00  
B23K 26/06  
H01S 3/121